

05.4

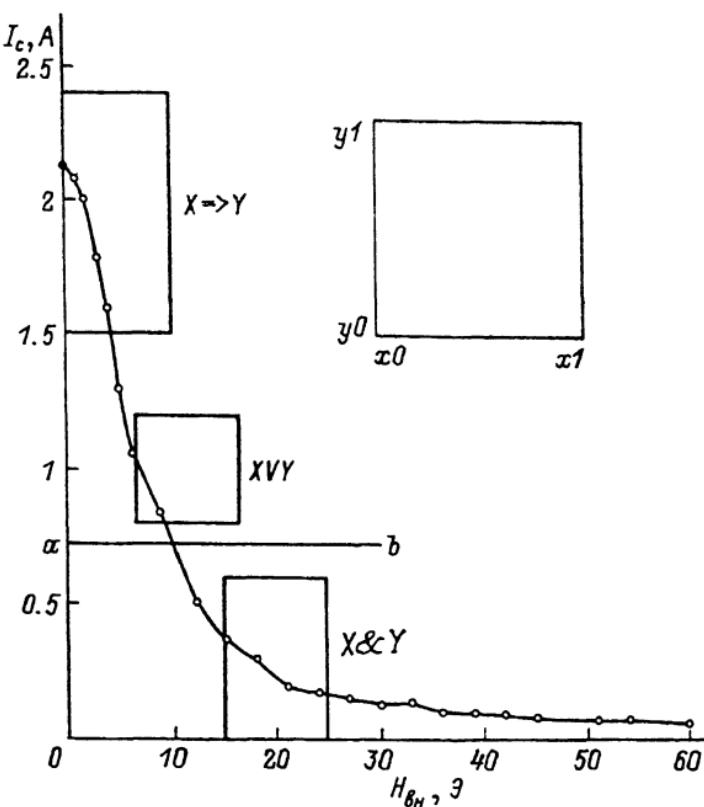
©1994

**ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ
И ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ**

В.А.Финкель, М.А.Яструбенецкий

Идея создания устройств логики и памяти на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), способных функционировать в азотном диапазоне температур, возникла сразу же после открытия явления высокотемпературной сверхпроводности в 1986 г. Преобладающее большинство исследований посвящено разработке сверхпроводниковых электронных ВТСП приборов на основе квантовых когерентных эффектов (см., например, [1,2]). Высокий уровень шумов в джозефсоновских контактах на основе керамических ВТСП материалов вызывает необходимость применения в этих приборах высококачественных пленок. Созданию же более простых переключательных и логических сверхпроводниковых устройств — криотронов, т.е. проводов или пленок, переключаемых из сверхпроводящего (S) в нормальное (N) состояние при помощи магнитного поля [3] — уделяют сравнительно мало внимания. Ранее обсуждалась возможность создания криотрона на основе сильно анизотропных монокристаллов ВТСП [4], в котором управляющий ($I_{\text{упр}}$) и рабочий ($I_{\text{раб}}$) токи протекают вдоль различных кристаллографических направлений, что в силу анизотропии верхних критических полей H_{c2} позволяет путем изменения величины $I_{\text{упр}}$, а следовательно, и создаваемого этим током магнитного поля $H_{\text{упр}}$, переводить кристалл из S - в N -состояние в направлении распространения $I_{\text{раб}}$.

Цель настоящей работы — показать, что на базе поликристаллических ВТСП материалов могут быть созданы работоспособные переключательные и логические элементы (ВТСП криотроны), обладающие более широкими функциональными возможностями, чем их низкотемпературные аналоги. При этом конструкция “классического” низкотемпературного проволочного криотрона [3] принципиальных изменений не претерпевает: рабочее тело (вентиль) представляет собой, как правило, керамическую прессовку или



Полевая зависимость критического тока ВТСП керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ и генерирование одноаргументной логической функции — функтора отрицания (путь ab) — и двухаргументных логических функций: конъюнкции ($X \& Y$), дизъюнкции (XVY) и математической импликации ($X \Rightarrow Y$). В правом верхнем углу представлена схема задания логических переменных $x0$, $x1$, $y0$, $y1$ для всех двухаргументных функций.

проводку из ВТСП с критической температурой T_c выше температуры кипения жидкого азота (77.3 K); магнитное поле создается при помощи соленоида, который в силу достаточно высокой теплоемкости жидкого азота может быть выполнен из металлической проволоки с высокой электропроводностью. Работа ВТСП криотрона основывается на наличии сильной зависимости критического тока I_c керамических ВТСП от напряженности внешнего магнитного поля H_{Bn} .

Для примера на рисунке представлена типичная зависимость $I_c(H_{Bn})$ для параллелепипеда из ВТСП керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ с $T_c \sim 92$ K размерами $\sim 2 \times 2 \times 10$ мм (эту зависимость можно рассматривать в качестве фазовой диаграммы [5] ВТСП криотрона). Очевидно, что область устойчи-

вой (т. е. обратимой) работы ВТСП криотрона ограничивается условием $H_{\text{вн}} < H_{c1}$, где H_{c1} — первое критическое поле сверхпроводника второго рода, к каковым относятся все ВТСП, при котором начинается проникновение магнитного поля в сверхпроводник и захват магнитного потока. Строго говоря, должно выполняться более строгое условие $(H_{\text{вн}} + Y_{\text{соб}}) < H_{c1}$, где $H_{\text{соб}}$ — поле, создаваемое сверхпроводящим током, но вблизи H_{c1} для керамических ВТСП это поле достаточно мало. По нашим данным, для данного образца ВТСП поле $H_{c1} = 37 \pm 1$ Э.

Естественно, что при $I_{\text{раб}} = \text{const}$ и при изменении $H_{\text{вн}}$ от величины $H_{\text{вн}} < H_{S-N}(I_{\text{раб}})$ до $H_{\text{вн}} > H_{S-N}(I_{\text{раб}})$, где $H_{S-N}(I_{\text{раб}})$ — критическое значение магнитного поля, при котором сверхпроводник, несущий ток $I_{\text{раб}}$, переходит из S -в N -состояние (путь ab на рисунке) работа ВТСП криотрона ничем не отличается от работы его низкотемпературного аналога: вентиль переключается из сверхпроводящего в нормальное состояние при $H_{\text{вн}} > H_{S-N}(I_{\text{раб}})$. На языке математической логики это означает, что при помощи ВТСП криотрона можно генерировать одноаргументную логическую функцию — функтор отрицания [6].

В отличие от проволочного (или ленточного) [3] и джозефсоновского [7] криотронов, для которых $I_{\text{раб}}$ — величина весьма малая и постоянная, рабочие токи ВТСП криотрона отнюдь не малы (см. рисунок). Это открывает принципиально новую возможность — перейти от одноканального управления состоянием криотрона (по магнитному полю) к двухканальному — по магнитному полю и по току. Наличие двух каналов управления открывает возможность генерировать при помощи ВТСП криотрона двухаргументные логические функции. Если за первую логическую переменную (x) принять $H_{\text{вн}}$ (или $I_{\text{упр}}$, создающий поле $H_{\text{вн}}$), а за вторую (y) — $I_{\text{раб}}$ и положить, что S -состоянию отвечает значение логической функции, равное нулю, а N -состоянию — единице, то при соответствующем выборе логических переменных, как это показано на рисунке, легко могут быть получены основные двухаргументные логические функции: конъюнкция или логическое умножение ($X \& Y$), дизъюнкция или логическое сложение ($X \vee Y$) и материальную импликацию ($X \Rightarrow Y$). Способы генерирования этих функций схематически показаны на рисунке “на фоне” реальной фазовой характеристики.

Как переключательный элемент ВТСП криотрон имеет повышенную надежность по сравнению с низкотемпературным аналогом, поскольку управление им может осуществляться по двухканальной схеме — по полю и по току.

Немаловажным обстоятельством в пользу реализации ВТСП криотронов является то, что требования к применяемым материалам в данном случае невысоки — низкие критические токи и достаточно резкая вольтамперная характеристика, что вполне достижимо при современном уровне технологии высокотемпературных сверхпроводников.

Список литературы

- [1] Gallagher W.J. // Solid State Technol. 1989. V. 32. N 11. P. 151.
- [2] Куприянов М.Ю., Лихарев К.К. // УФН. 1990. Т. 160. В. 1. С. 49.
- [3] Buck D.A. // Proc. IRE. 1956. V. 44. P. 482.
- [4] Волков А.Ю. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 4. С. 11.
- [5] Формозов Б.Н. Экспериментальная техника в физике сверхпроводников. Киев, 1987. С. 174.
- [6] Карри Х. Основания математической логики. М., 1969. С. 65.
- [7] Алфеев В.Н., Бахтин П.А., Васенков А.А. и др. Интегральные схемы и микроэлектронные устройства на сверхпроводниках. М., 1985. С. 36.

Национальный научный центр
“Харьковский
физико-технический институт”
Институт безопасности и надежности
технологических систем
Харьков

Поступило в Редакцию
14 марта 1994 г.